

2011年3月期第2四半期決算説明会資料

～電子デバイスシステムの好調により、業績予想を上方修正～

2010/10/26

 株式会社日立ハイテクノロジーズ

執行役社長 大林 秀仁

2011年3月期第2四半期 決算説明会

I 2011年3月期第2四半期累計期間 決算概要

II 2011年3月期 業績予想

III 参考:データ集

I

2011年3月期第2四半期累計期間 決算概要

(注)YY/MはYY年M月期を表しています。
(e)は、前回予想(2010年7月公表値)

2011年3月期第2四半期累計期間(ハイライト)

(億円)

	当期実績	前年同期比		前回予想比	
		増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	3,353	+536	+19%	+123	+4%
営業利益	138	+214	—	+48	+53%
経常利益	143	+213	—	+51	+56%
当期利益	98	+151	—	+36	+58%
一株利益	71円11銭	+109円69銭		+26円03銭	
一株配当	10円00銭	+5円00銭		±00円00銭	
FCF	+87	+152		+39	

* 前回予想(2010年7月公表値)

2011年3月期第2四半期累計期間(偏差説明)

対前回予想値(2010年7月1Q決算発表時)比較

売上高 (3,230億円 → 3,353億円 +123億円)

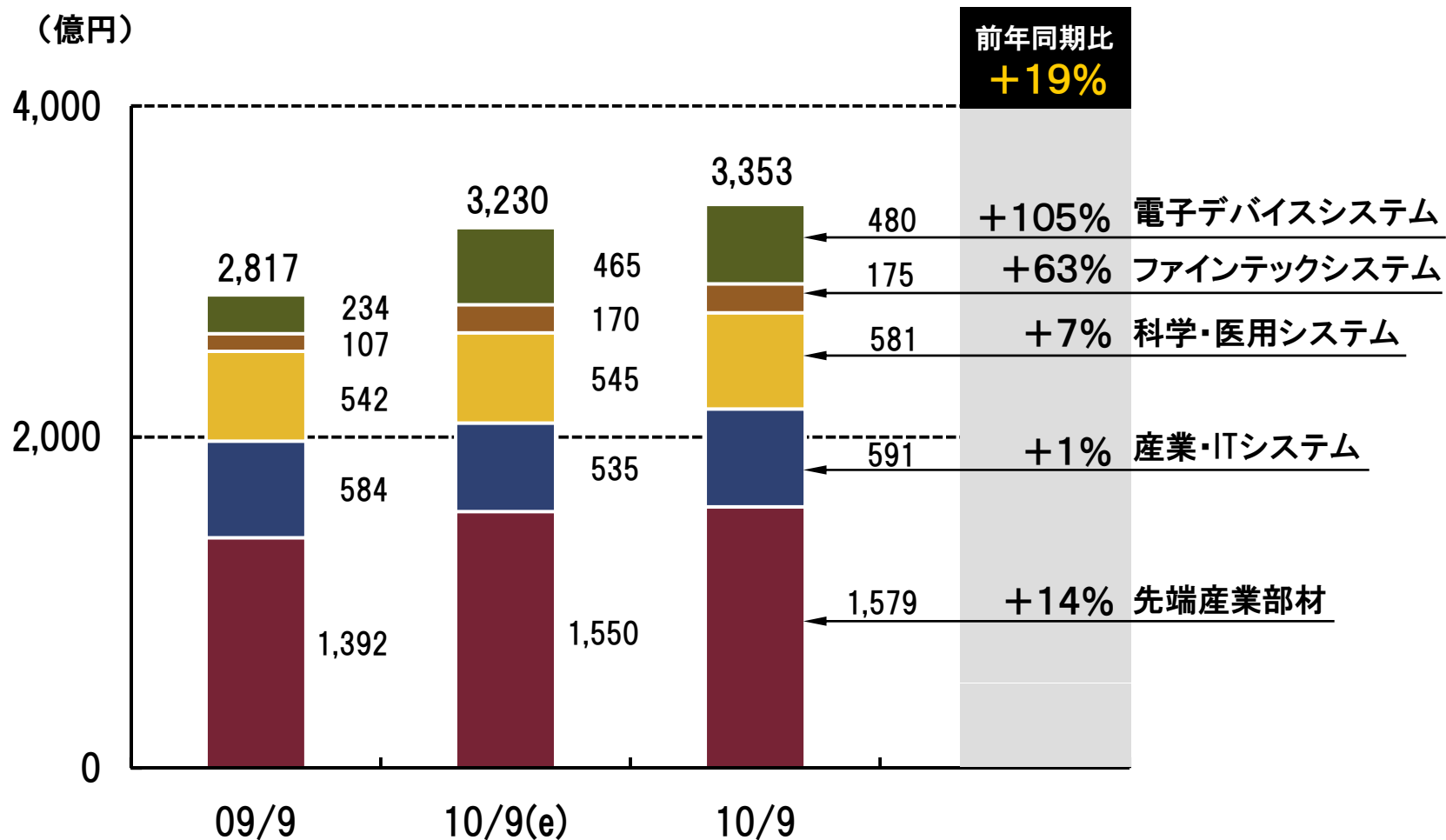
- 科学・医用システム: 医用分析装置の出荷前倒し等により36億円増加
- 産業・ITシステム: 米国向け携帯電話の売上増等により56億円増加
- 先端産業部材: 自動車部品の需要増等により29億円増加

営業利益 (90億円 → 138億円 +48億円)

- 電子デバイスシステム: 半導体後工程装置の売上増および操業度改善等により22億円増加
- 科学・医用システム: 医用分析装置の出荷増等により15億円増加

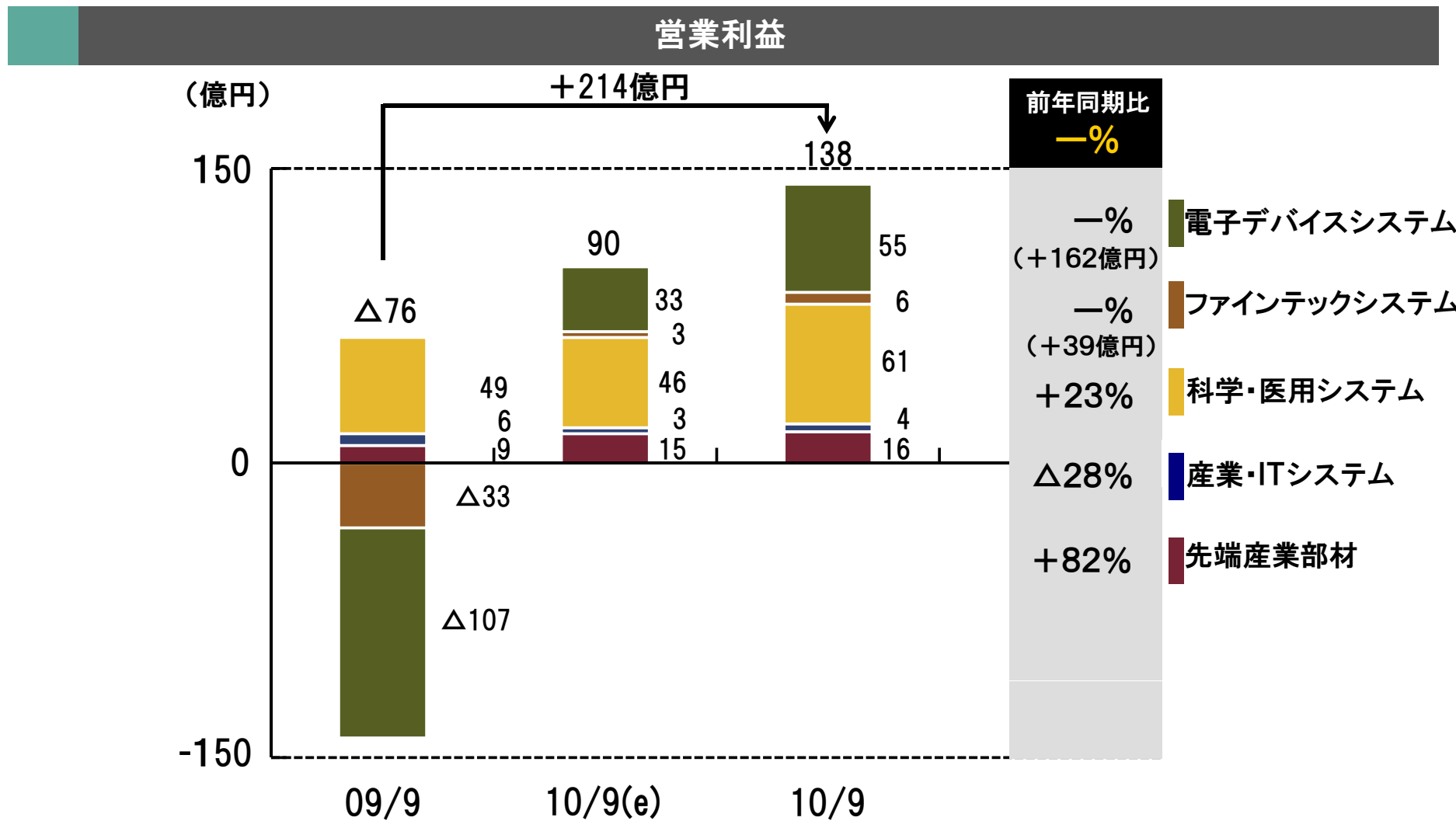
経営成績(セグメント別売上高)

売上高



(注)合計にはセグメント間の内部取引の消去等が含まれております。

経営成績(セグメント別営業利益)



(注)合計にはセグメント間の内部取引の消去等が含まれております。

財政状態(貸借対照表〔要約〕)

2010年9月末 (億円)

		10/3末比			10/3末比	
流動資産		3,328	+80	流動負債	1,556	△2
現預金、関係会社預け金	921	△97	支払手形及び買掛金	1,098	△2	
受取手形及び売掛金	1,459	+14	その他	457	+0	
たな卸資産	710	+138	固定負債	269	+10	
その他	238	+25	退職給付引当金	259	+6	
固定資産	856	△7	その他	10	+4	
有形固定資産	557	△2	純資産	2,359	+65	
無形固定資産	61	+12	株主資本	2,377	+84	
投資その他の資産	237	△17	評価・換算差額等	△19	△17	
			少数株主持分	1	△2	
資産合計	4,184	+73	負債及び純資産合計	4,184	+73	

財政状態(キャッシュ・フロー計算書〔要約〕)

(億円)	10/1H		10/1H
営業活動による キャッシュ・フロー	+2	財務活動による キャッシュ・フロー	△16
税引前利益	+137	配当金の支払	△14
減価償却費	+41	その他	△2
運転資金	△154	換算差額	△19
法人税等支払・還付額	△19		
その他	△3		
投資活動による キャッシュ・フロー	+84		
有価証券の取得・売却	+0		
固定資産取得・売却	△27		
その他	+111		
フリー・キャッシュ・フロー	+87		
		現金及び現金同等物	10/1H
		期首残高	+902
		増減額	+52
		期末残高	+954

Ⅱ

2011年3月期 業績予想概要

(注)YY/MはYY年M月期を表しています。
(e)は、前回予想(2010年7月公表値)
(e1)は、今回予想(2010年10月公表値)

2011年3月期業績予想(ハイライト)①

(億円)

	当年度予想	前年同期比		前回予想比	
		増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	6,800	+631	+10%	+100	+1%
営業利益	255	+271	—	+53	+26%
経常利益	260	+265	—	+55	+27%
当期利益	170	+198	—	+44	+35%
一株利益	123円60銭	+144円15銭		+31円99銭	
一株配当	20円00銭	+5円00銭		±00円00銭	
ROE	7.2%	+8.4%		—	
FIV	+39	+161		—	
FCF	+125	△16		+77	

(注)想定レート: 1USD= 87円
1EUR=108円

* 前回予想(2010年7月公表値)

2011年3月期業績予想(ハイライト)②

為替変動への対策

■ 想定レートの変移

	期初(2010/4)		前回(2010/7)		今回(2010/10)	
	1H	2H	1H	2H	1H*	2H
USD	85.00	85.00	90.00	85.00	89.40	87.00
EUR	125.00	125.00	110.00	125.00	114.20	108.00

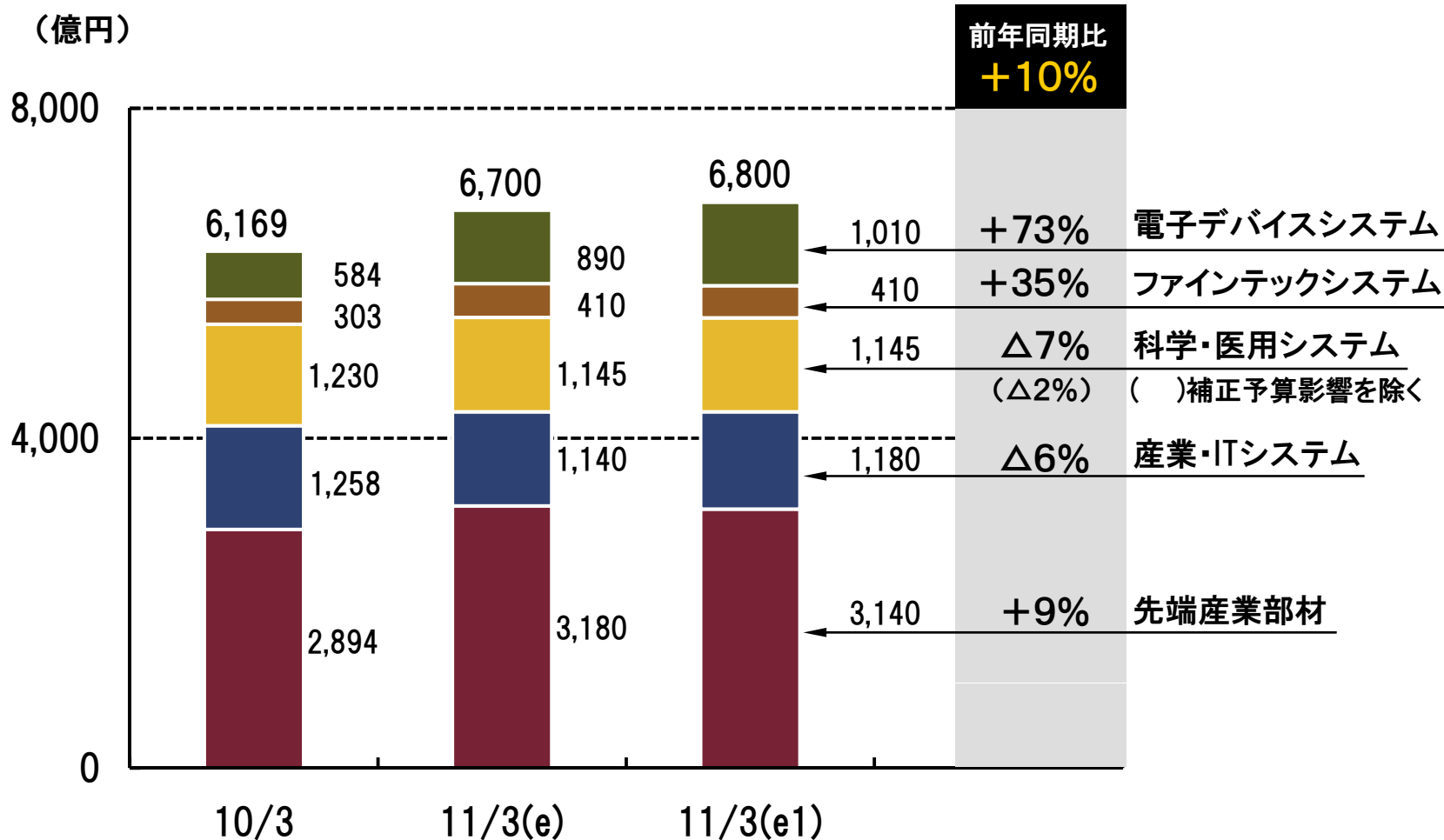
*10/1Hは実績レート

■ 為替変動への対策

- ・外貨建取引は成約時に先物為替予約によりヘッジ
→10/2Hについては、上記想定レートにより為替リスクは概ね対策済
- ・海外調達・生産を強化

2011年3月期業績予想(セグメント別売上高)

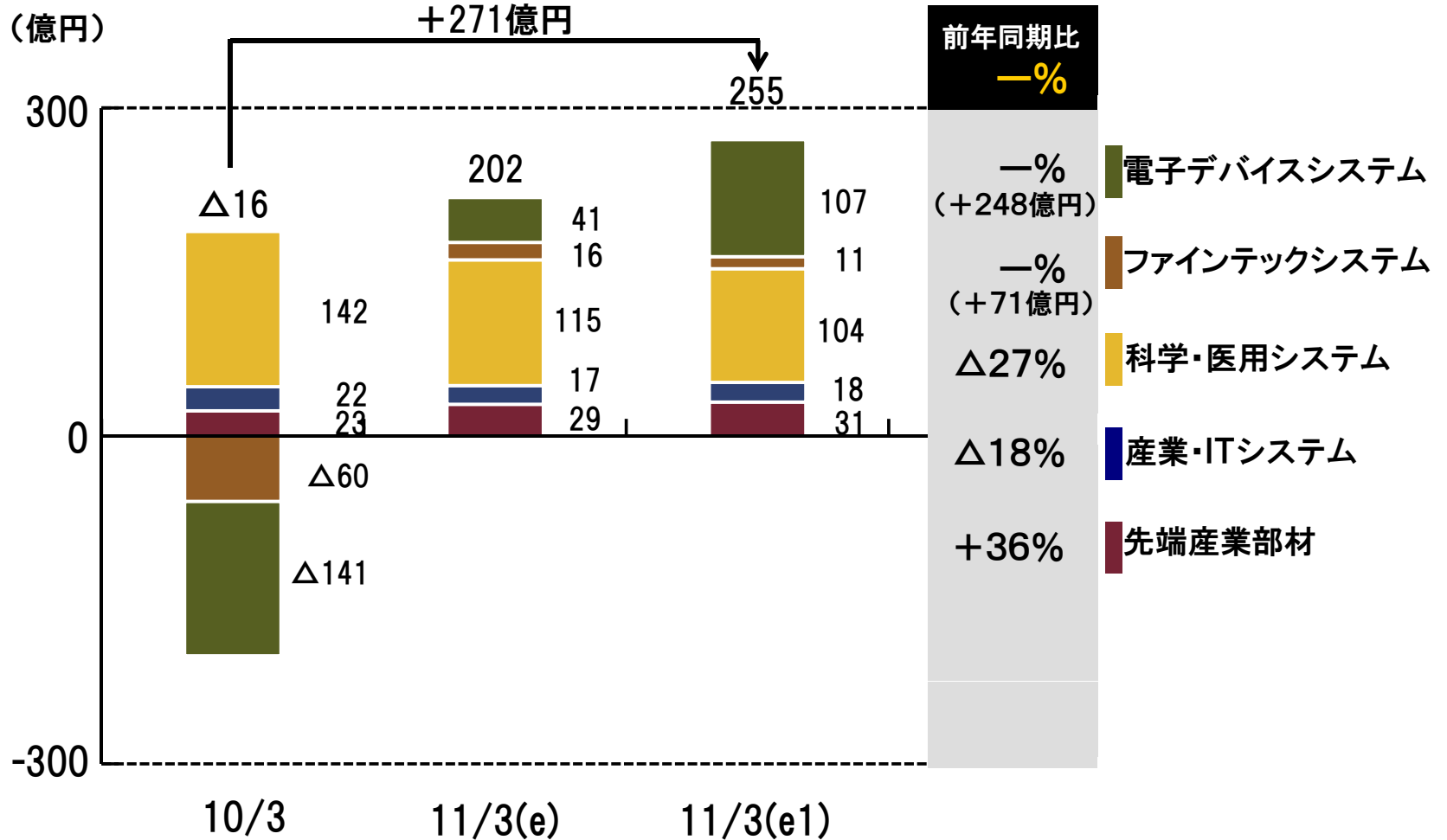
売上高



(注)合計にはセグメント間の内部取引の消去等が含まれております。

2011年3月期業績予想(セグメント別営業利益)

営業利益



(注)合計にはセグメント間の内部取引の消去等が含まれております。

半導体デバイス・製造装置市場動向

半導体デバイス市場

- モバイルPCやスマートフォンなどモバイル機器が好調のため、10年度半導体デバイス市場は回復(09年度:251B\$ → 10年度:295B\$) PCは10年度下期一時的な在庫調整が行われるが、新興国・企業向けが下支えし長期化せずボトムアウト
- 11年度もNAND、MPU、ASSPとも成長の見通し。DRAMは価格低下により販売高は今年度比△5～△7%の見込みだが、ビット成長率は引き続き高くDRAM増産は継続

半導体製造装置市場

- 10年度上期に市場は急回復し、10年度は対前年度比+87%の見通し
- 10年度後半～11年度始めに一時的なディップの可能性あるが、長期化せず11年度も10年度と同等の市場規模を見込む
- 最先端DRAM(3Xnm)、NAND(2Xnm)、ロジック(2Xnm)の量産移行への投資が進み、先端メモリー、ファウンドリ中心に新規ファブ建設予定

2011年3月期業績予想(電子デバイスシステム)②

半導体デバイスの微細化動向について

微細化目的の変化

- ・従来 高性能化+低コスト化
- ・今後 低コスト化+小型化

先端NAND、ロジック、DRAMで微細化加速

次世代リソグラフィーの動向

- ・本命はEUV(極遠紫外線)リソグラフィー
但し、実用化は遅延する見込み
- ・当面は光リソ+ダブルパターニング(DP)
DPはパターンピッチ1/2化が可能
DPプロセスの技術革新の可能性有

当社は次世代微細化へのソリューションを開発中

- ・DP用エッチング装置
- ・DP用チップ内合わせ誤差測定:CD-SEM
(IBMとの共同研究成果)

表 微細化が加速(NANDフラッシュ) 単位:nm

年	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ITRS' 09 Flash hp	32	28	26	23	20	18
先端Flash 微細化計画	32	27~21	18~16		14~11	

ITRS: International Technology Roadmap for Semiconductors

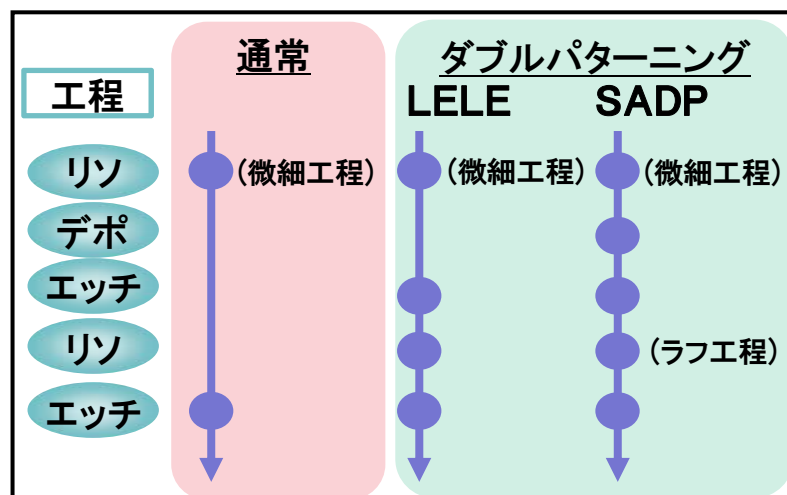


図 ダブルパターニングの工程

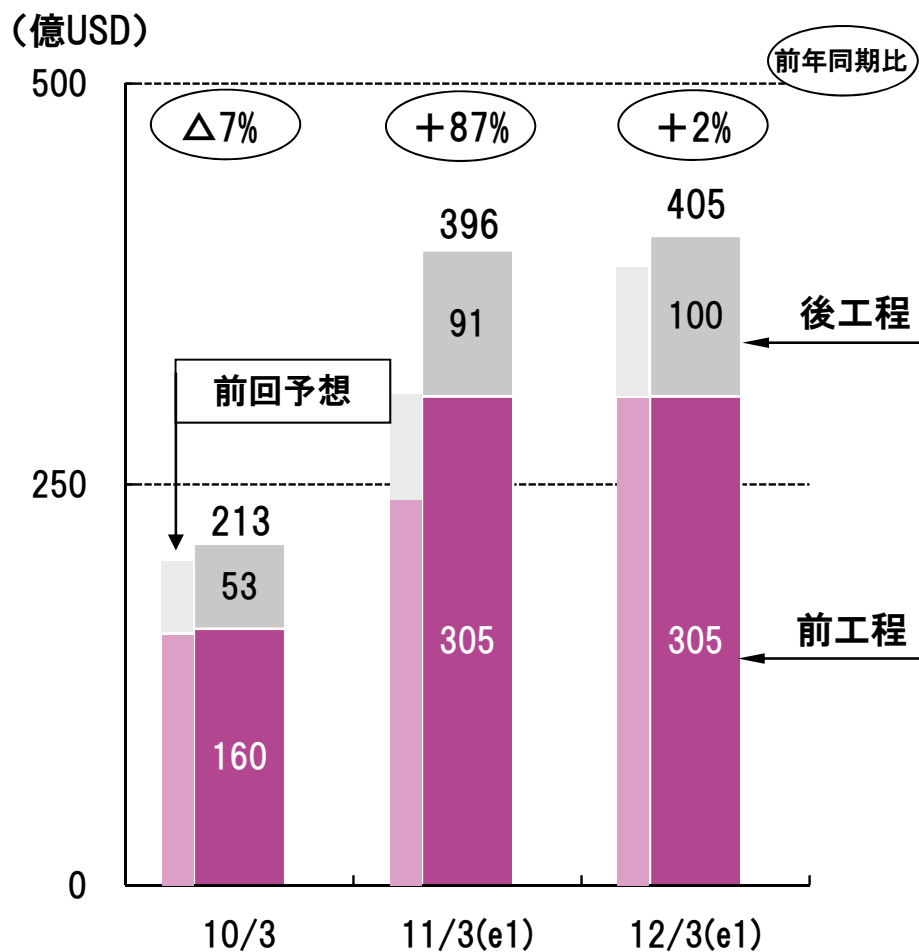
ダブルパターニングは

- ・リソとエッチング工程が増加
- ・加工工程増加に伴い計測評価項目増加

LELE:Litho-Etch-Litho-Etch, SADP:Self-Align DP

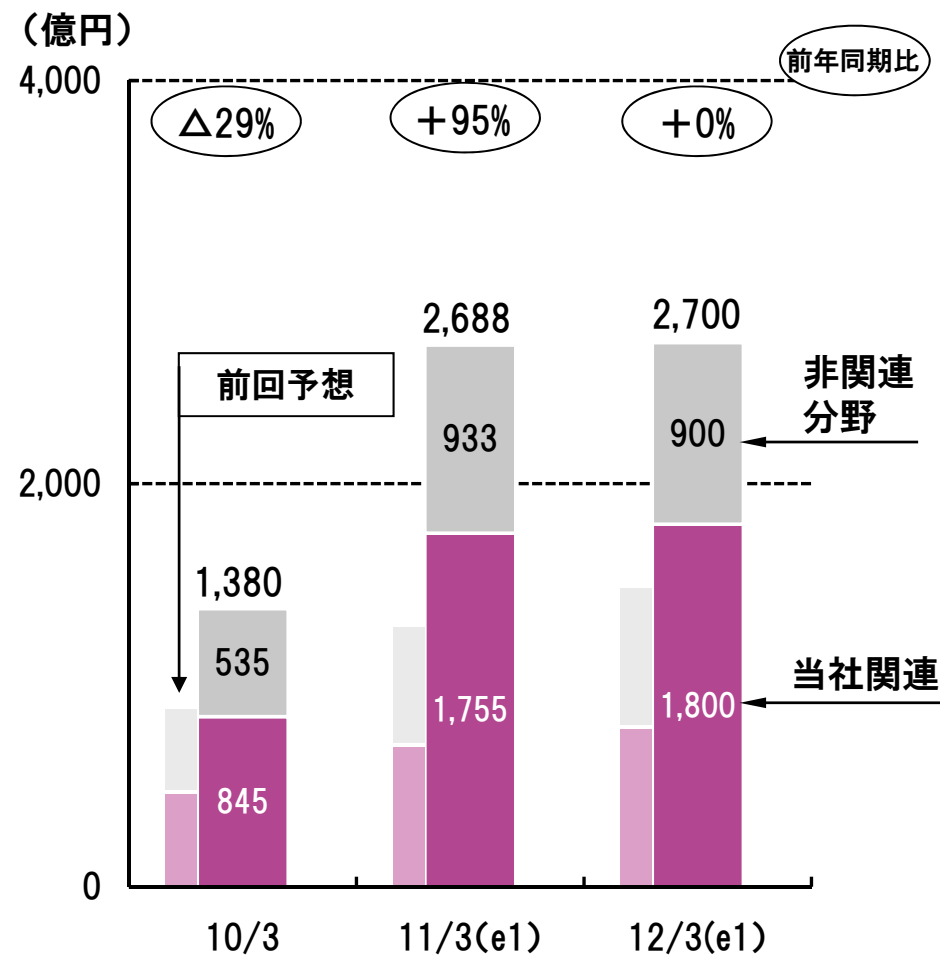
2011年3月期業績予想(電子デバイスシステム)③

半導体製造装置市場



(出所)Gartner(10年9月)および当社推測
 前回予想はGartner(10年3月) および当社推測

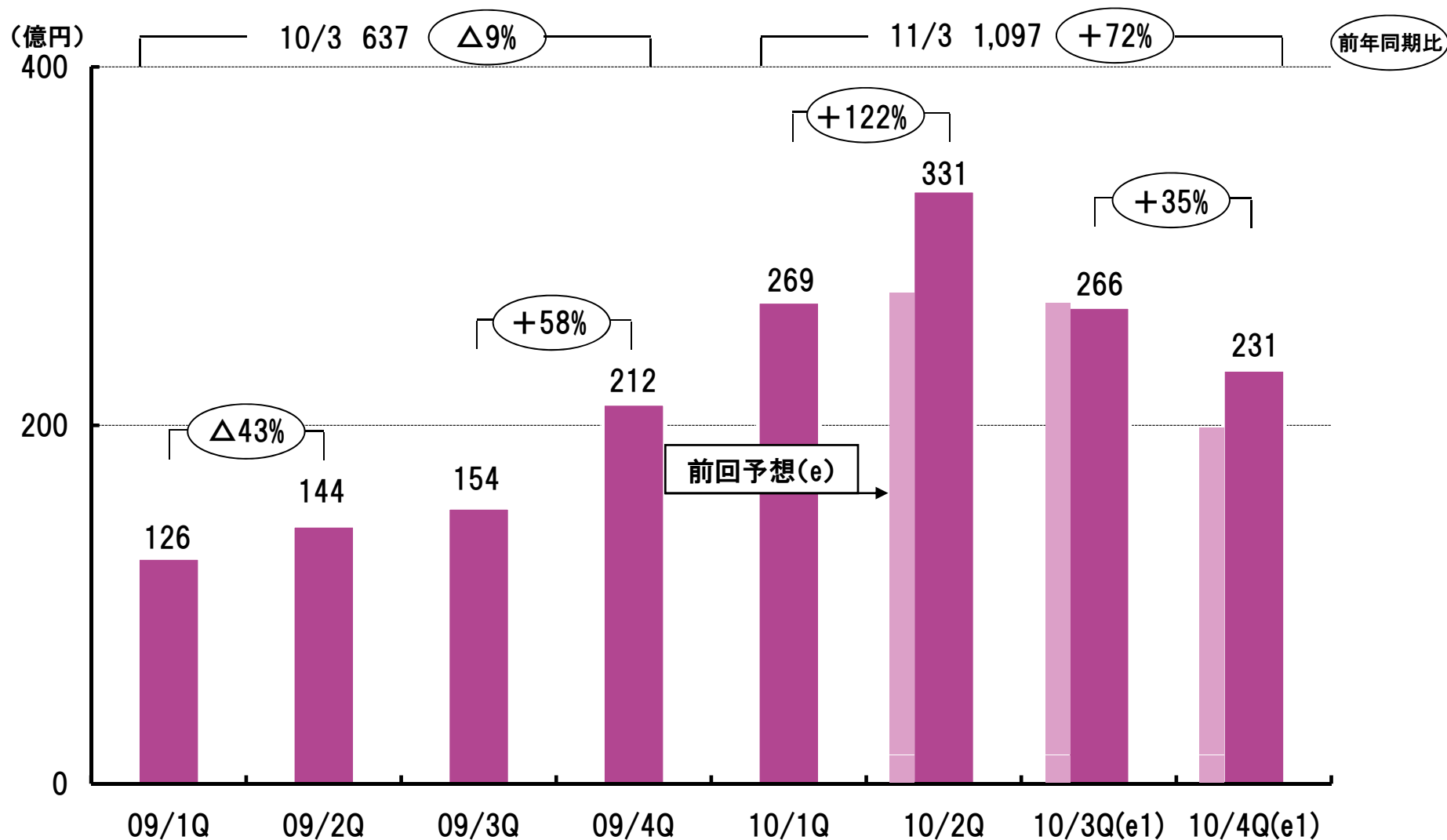
実装装置市場



(出所)日本ロボット工業会資料(10年7月)調査機関資料に基づき当社作成
 前回予想は10年4月の10年3月期決算発表時の見通し

2011年3月期業績予想(電子デバイスシステム)④

受注高の推移



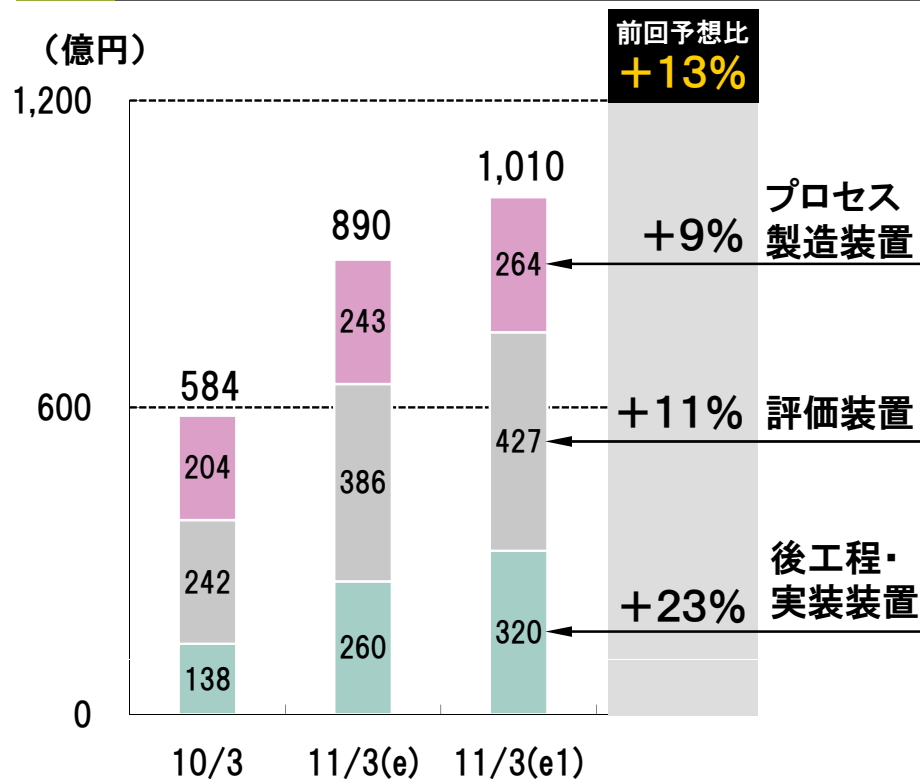
(注)前年同期比は、08年度露光装置を除いた数値となっております。 Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

2011年3月期業績予想(電子デバイスシステム)⑤

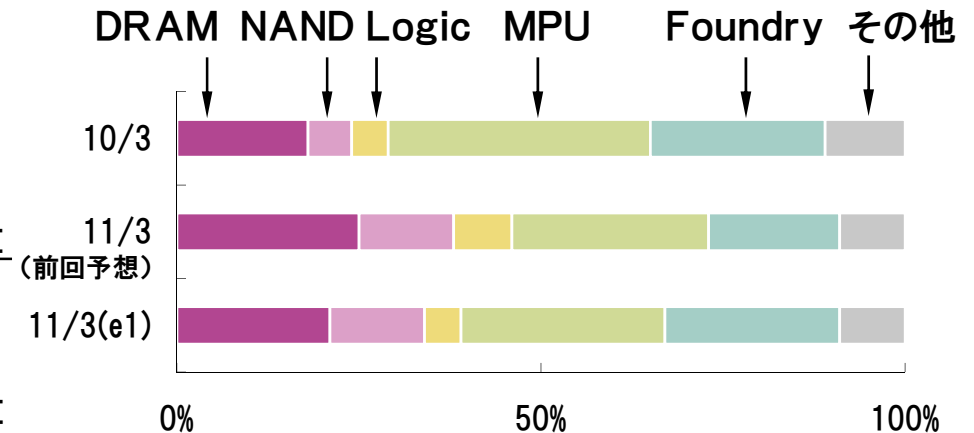
今後の取り組み

1. 前工程・後工程装置: 成長分野の取り込みと微細化への対応を促進し受注を確保
2. チップマウンタ: 新規顧客の開拓と現ユーザーのCS向上による市場成長以上のシェアアップ

主要製品群別売上高の推移



前工程装置 分野別売上高比率



(注) 前回予想は、10年4月の10年3月期決算発表時の見通し

09年度: 市場全体が縮小するなか、MPUメーカーからの売上確保、後半はファウンドリも好調
 10年度: MPU、ファウンドリは引き続き堅調
 DRAM、NANDメーカーの投資再開により相対的に比率が上昇

2011年3月期業績予想(ファインテックシステム)①

FPDパネル・HDの動向について

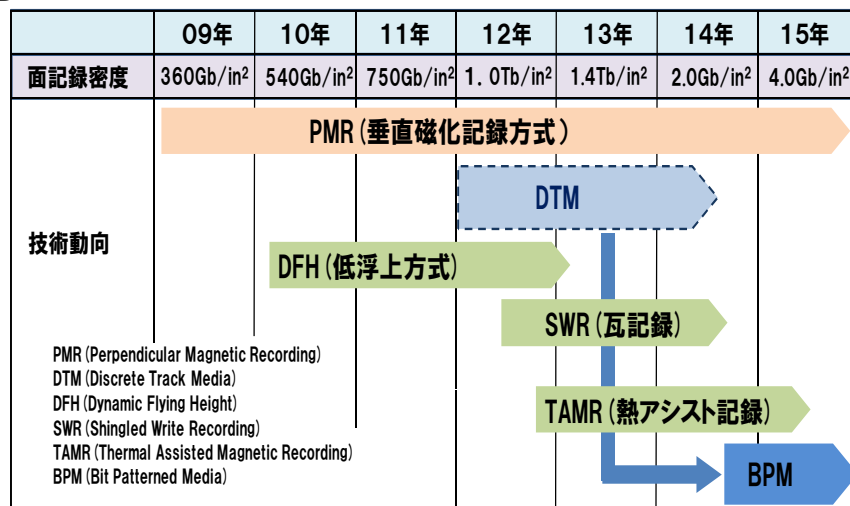
FPDパネル

FPDパネルの動向	技術トレンド	当社の対応
タッチパネル製品の増加	・静電容量方式の増加で微細パターン化進展	・露光装置 ITOアライメント機能の追加 重ね合せ精度の向上
高精細化の進展	・フルHD ⇒ 2k4k ⇒ 4k8k	
3D TVの本格普及	・高開口率化(光配向/PSA/COA) ・高速化(240Hz/480Hz駆動)	・実装装置 パネル補正機能の追加 新接合方式の導入
有機ELパネルの増加と大型化	・大型マザーガラス対応ライン	

PSA: Polymer Sustained Alignment COA: CF on Array ITO: Indium Tin Oxide

HD

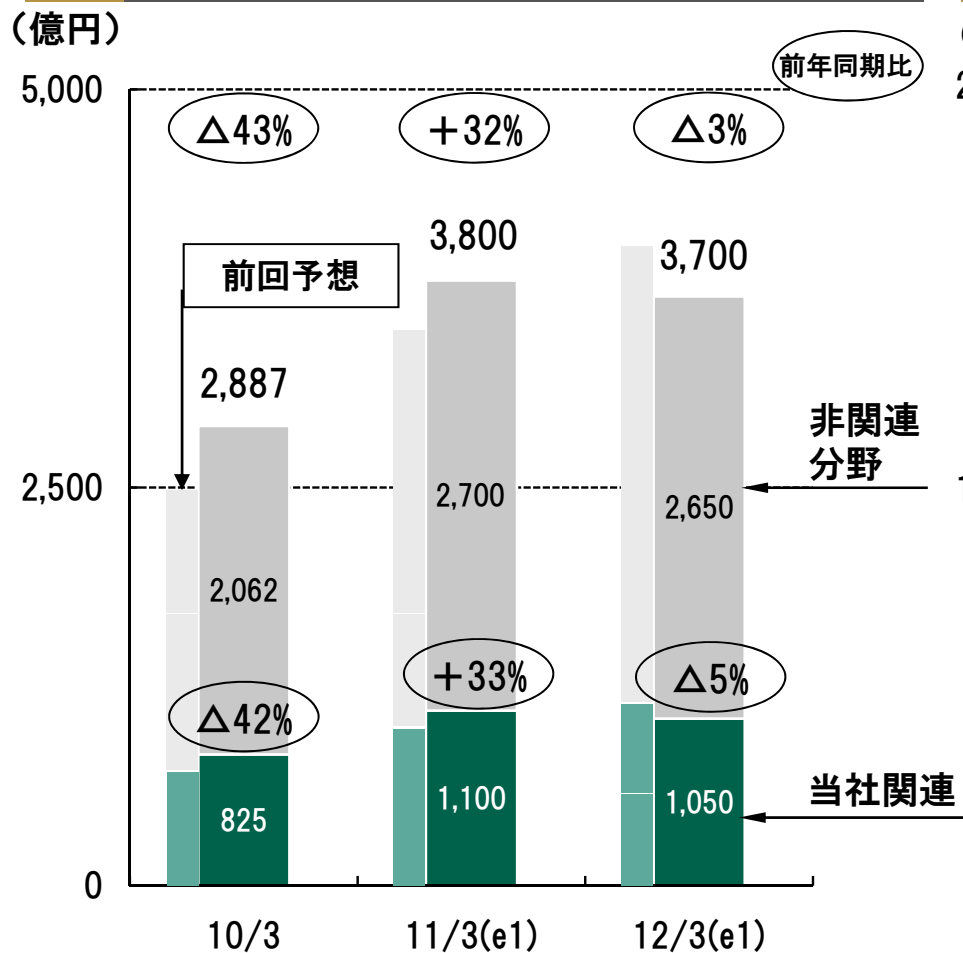
HDの技術動向



技術	当社対応装置	対応技術
DFH技術	光学式メディア検査装置	(高密度化対応) 低浮上 光学検査技術
SWR(瓦記録)技術		ヘッド関連検査装置
TAMR技術	光学式メディア検査装置	
BPM技術	インプリント装置	インプリント技術

2011年3月期業績予想(ファインテックシステム)②

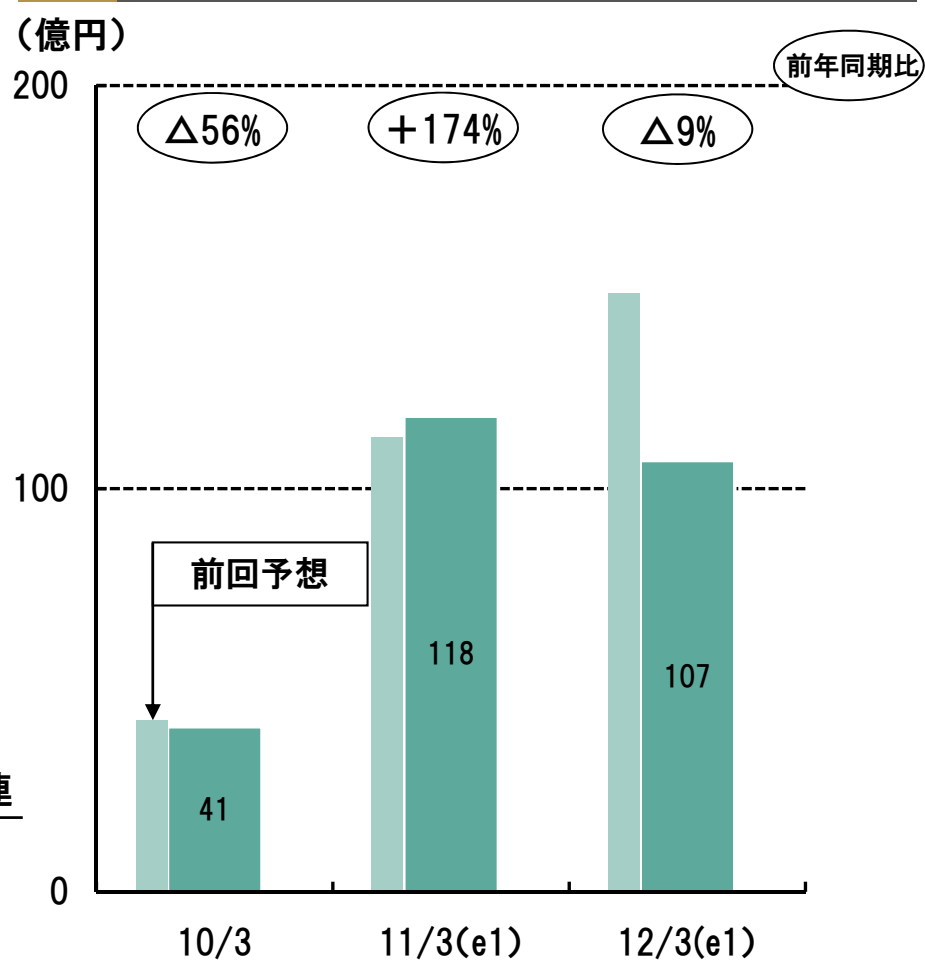
液晶関連製造装置市場



(出所)SEAJ(10年7月)日本製装置市場データに基づき当社にて推測

(注)前々予想は、10年4月の10年3月期決算発表時の見通し

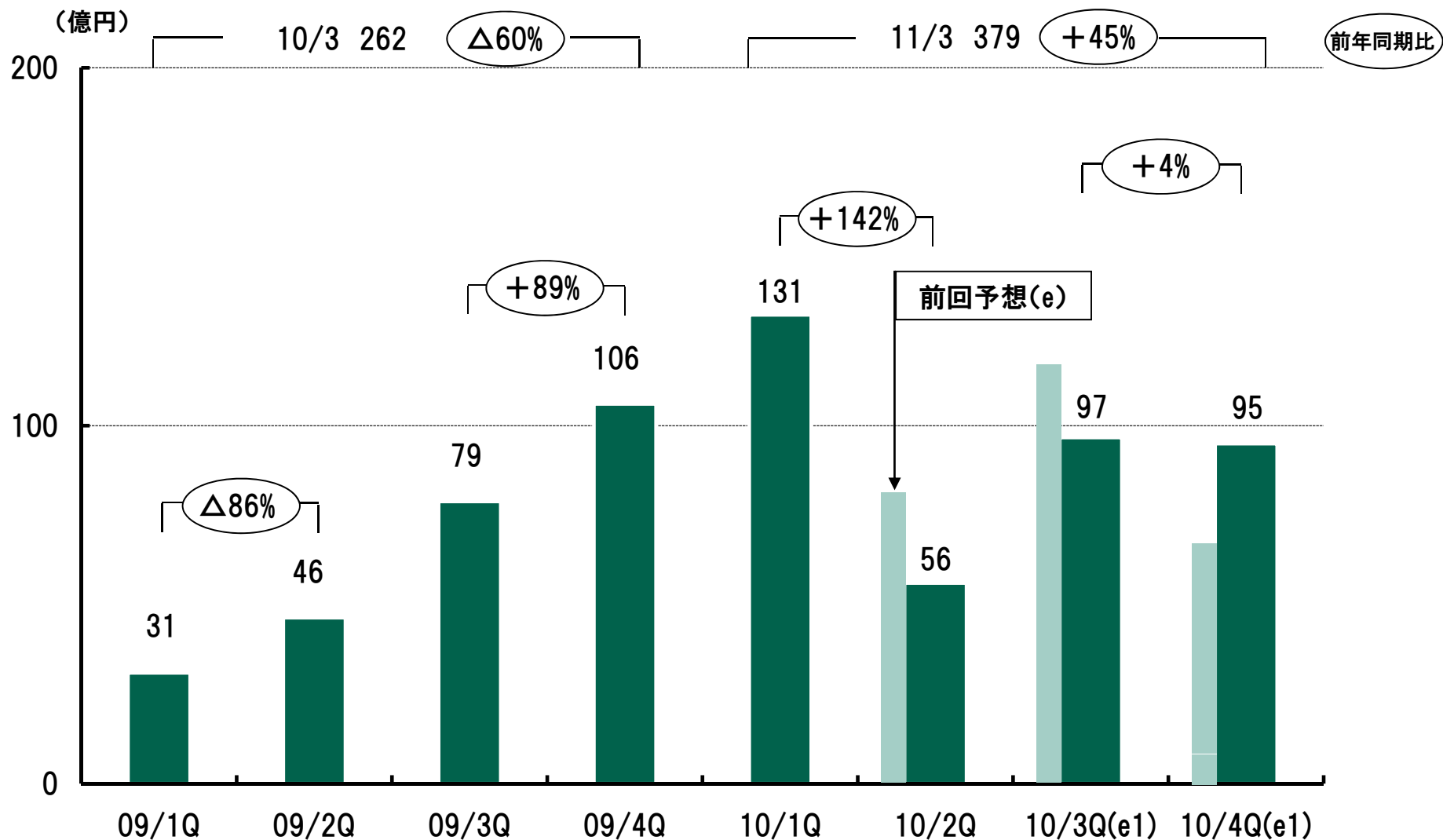
HD関連製造装置市場(当社関連)



(出所)当社推測

2011年3月期業績予想(ファインテックシステム)③

受注高の推移

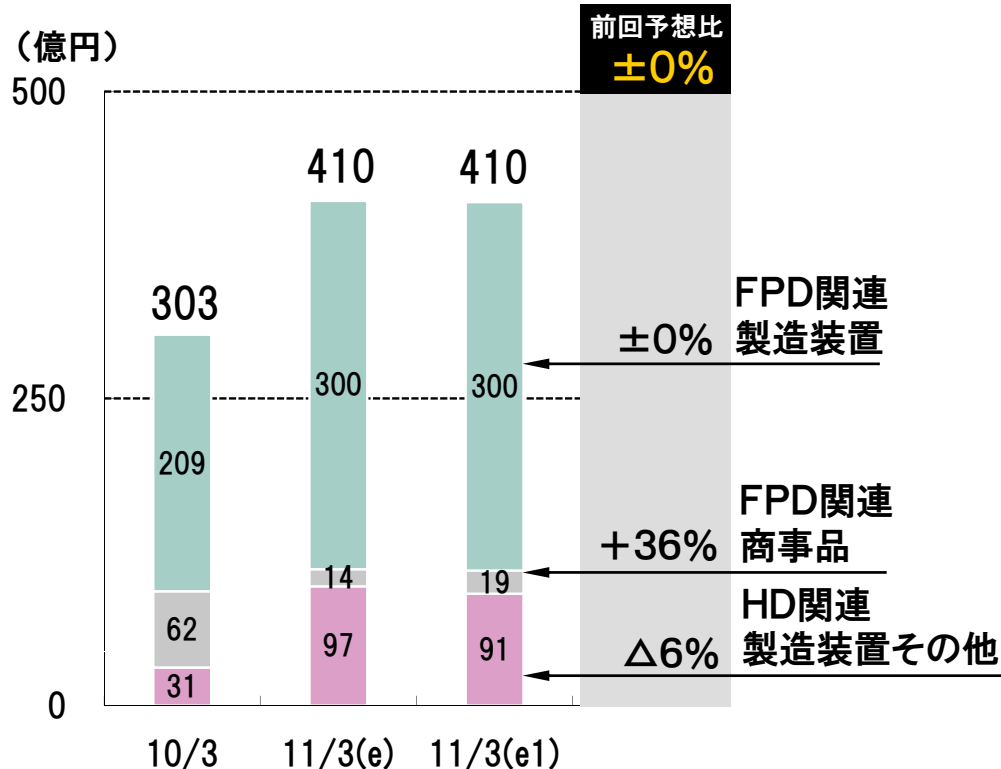


2011年3月期業績予想(ファインテックシステム)④

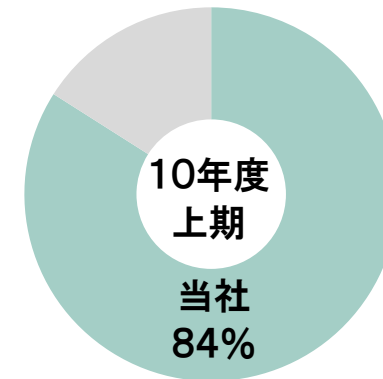
今後の取り組み

1. 製品競争力の向上による業界トップの地位確保(液晶露光装置・HD検査装置)
2. 新製品・新規事業開発の推進(有機EL製造装置)
3. 市場変動に強い事業体制への転換(グローバル調達の加速)

主要製品群別売上高の推移



カラーフィルタ用露光装置シェア(G8)



(出所)当社推測

- ・09年度までの累計シェアは68%
- ・マスク補正機構による細線BM対応とCOA対応により10/上のシェア向上

BM:Black Matrix

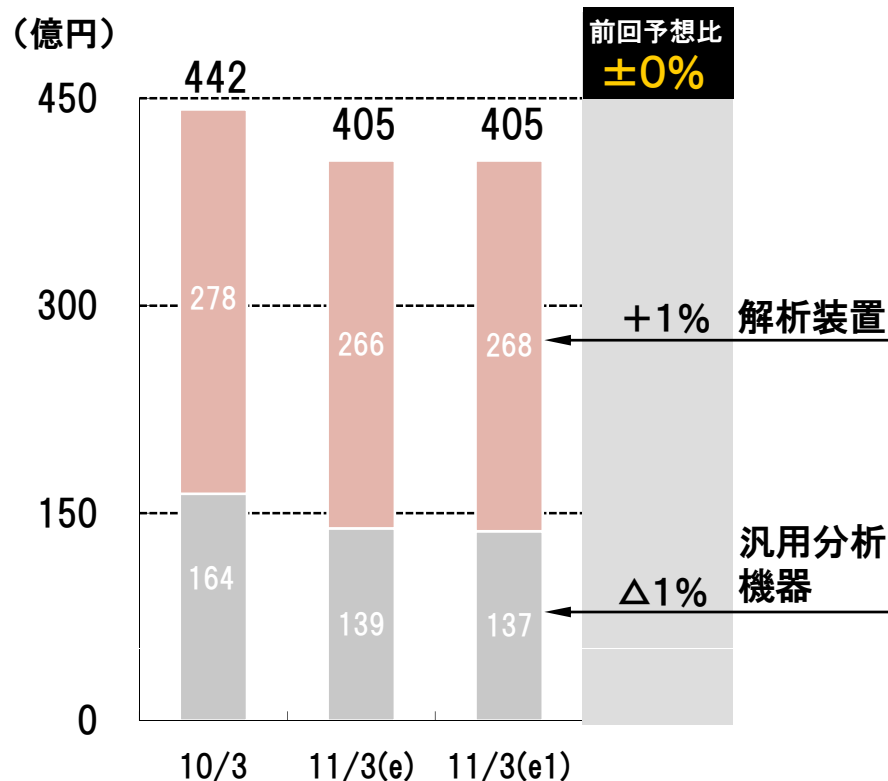
2011年3月期業績予想(科学・医用システム)①

今後の取り組み

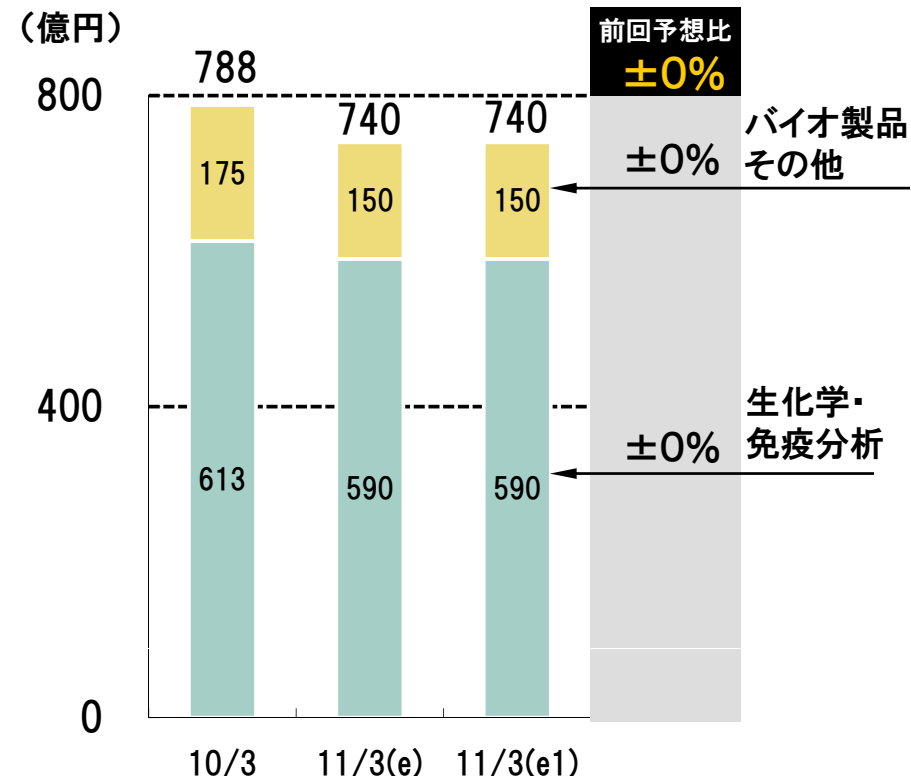
1. 分析関連事業: 成長市場(LiB、PV、LED、製薬等)への積極的な拡販
2. バイオ・メディカル事業: 国内外の有カメーカーとのSCBの推進

*SCB: System Collaboration Business

分析関連事業 売上高の推移



バイオ・メディカル事業 売上高の推移

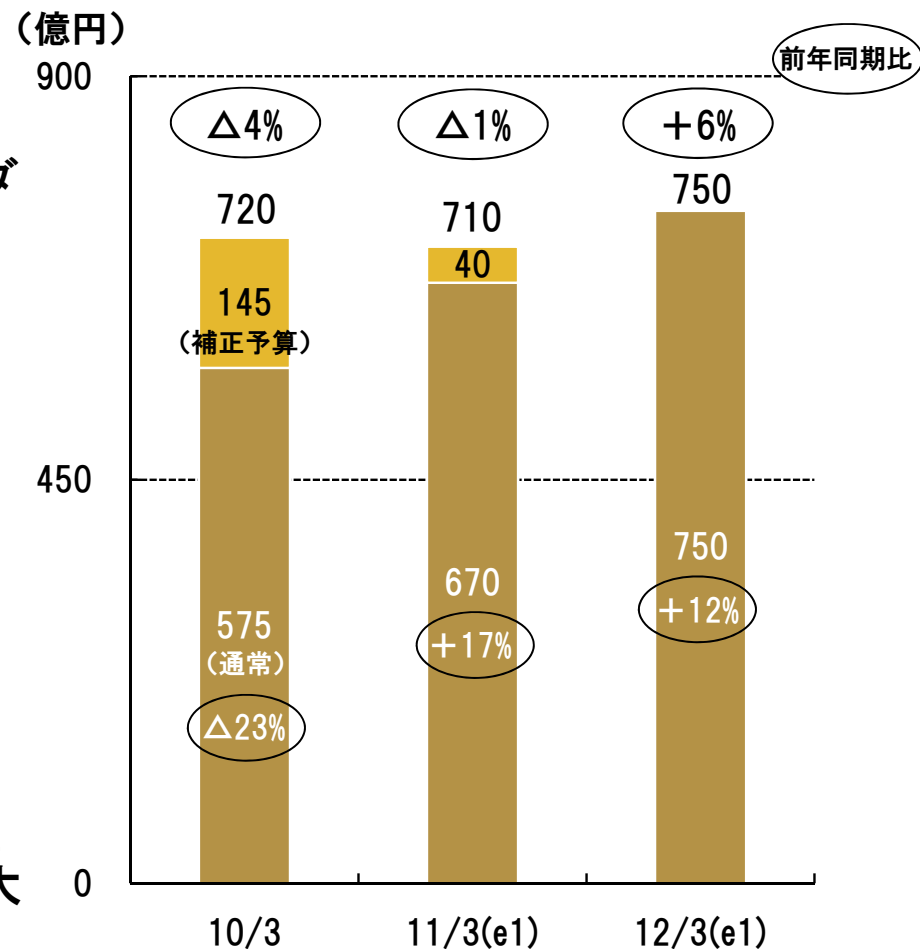


2011年3月期業績予想(科学・医用システム)②

解析装置市場の注力分野と今後の取り組み

- 環境・新エネルギー(LiB・PV等)関連市場
優位化技術である観察試料酸化防止ホールダなど新アプリケーション・アクセサリを活用した提案営業の推進
- 半導体デバイス関連市場
超高分解能FE-SEMおよびSTEMの拡販
- バイオ・食品・化学市場
イージーオペレーションを実現した新型バイオ分野向けTEMの市場投入による拡販
- 全般
小中学校から民間企業の品質管理まで、新型卓上顕微鏡による電子顕微鏡市場の裾野拡大

解析装置市場



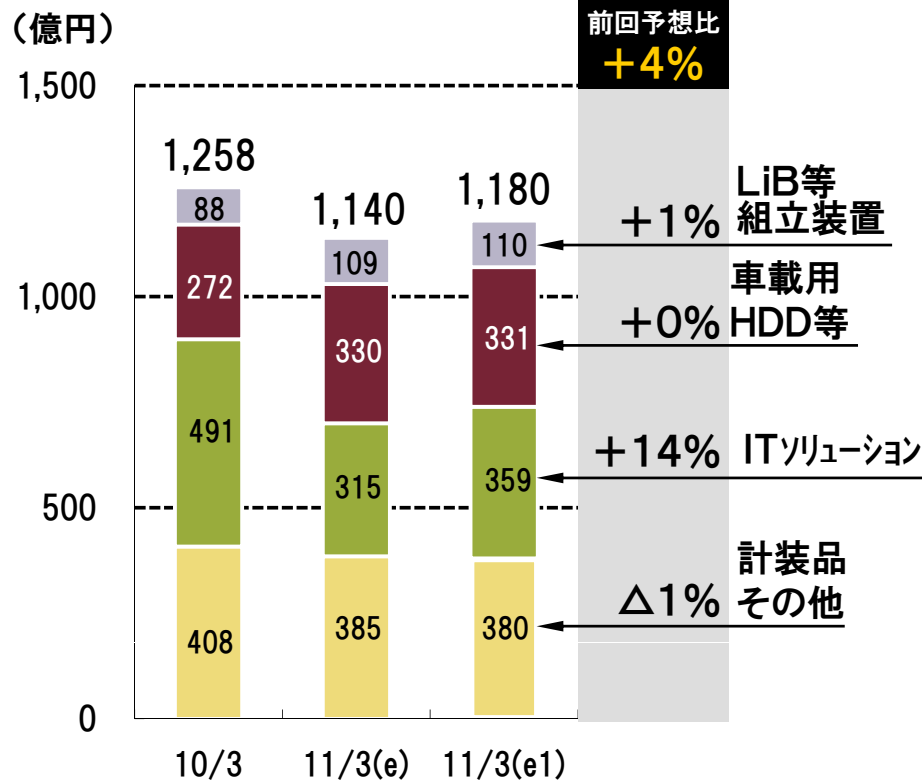
(出所)当社推測

2011年3月期業績予想(商事部門)

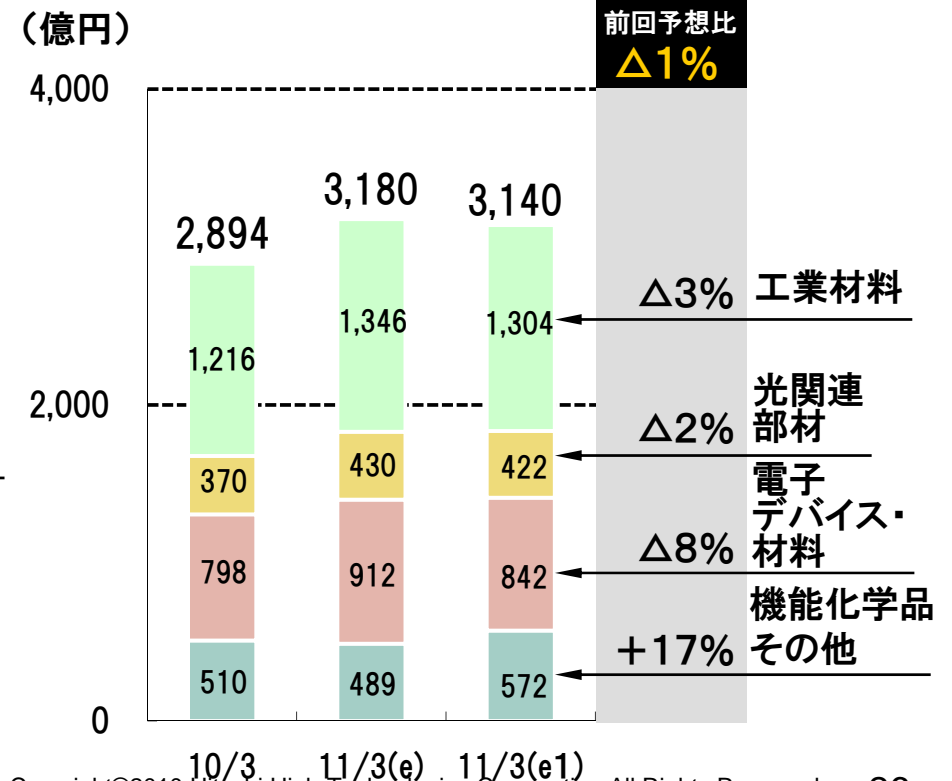
今後の取り組み

1. 太陽電池関連事業の拡大
2. アジアベルト地帯新興国での開発加速

産業・ITシステム 売上高の推移



先端産業部材 売上高の推移



IV

参考:データ集

(注)YY/MはYY年M月期を表しています。

四半期業績の推移

(億円)

			09年1Q	09年2Q	09年3Q	09年4Q	10年1Q	10年2Q
売上高 ／ 営業利益	電子デバイスシステム	売上高	105	129	141	209	169	311
		営業利益	△48	△59	△24	△11	7	48
	ファインテックシステム	売上高	59	48	53	143	67	108
		営業利益	△14	△19	△10	△17	△1	7
	科学・医用システム	売上高	242	301	266	422	275	306
		営業利益	21	28	32	61	30	31
	産業・ITシステム	売上高	275	309	284	391	296	295
		営業利益	△3	8	0	16	△3	7
	先端産業部材	売上高	661	730	732	771	802	777
		営業利益	7	2	7	8	11	5
	その他・消去又は全社	売上高	△16	△25	△24	△35	△24	△29
		営業利益	△1	1	△1	△1	△1	△4
	合計	売上高	1,325	1,492	1,451	1,901	1,585	1,768
		営業利益	△38	△38	4	56	43	95
経常利益			△32	△37	8	57	50	93
当期利益			△20	△33	△3	28	35	63

設備投資額・減価償却費・研究開発費/地域別売上高

■設備投資額・減価償却費・研究開発費

(億円)

	09/1H	10/1H	前年 同期比	10/3	11/3(e)	前年 同期比
設備投資額	52	40	△23%	94	114	+21%
減価償却費	46	41	△10%	96	96	+0%
研究開発費	94	103	+10%	193	224	+16%

(注)設備投資額は取得ベースにて記載

■地域別売上高

(億円)

		日本	北米	欧州	アジア	中国大陸	その他	計
09/1H	売上高	1,325	315	355	766	347	56	2,817
	構成比率	47.1%	11.2%	12.6%	27.2%	12.3%	2.0%	100.0%
10/1H	売上高	1,475	295	356	1,172	517	55	3,353
	構成比率	44.0%	8.8%	10.6%	34.9%	15.4%	1.6%	100.0%

主要製品群別売上高の状況

	09年1Q	09年2Q	09年3Q	09年4Q	10年1Q	10年2Q	(億円)
電子デバイスシステム	105	129	141	209	169	311	
プロセス製造装置	65	33	57	49	32	77	
評価装置	23	55	49	115	79	125	
後工程・実装装置	17	40	35	45	58	109	
ファインテックシステム	59	48	53	143	67	108	
FPD関連製造装置	52	42	48	131	56	78	
HD関連製造装置その他	6	6	5	12	11	30	
科学・医用システム	242	301	266	422	275	306	
汎用分析機器	29	39	40	66	27	44	
解析装置	31	67	46	124	36	79	
生化学・免疫分析装置	144	152	137	180	162	139	
バイオ製品その他	38	42	43	53	49	44	
産業・ITシステム	275	309	284	391	296	295	
LiB等組立装置	15	19	16	38	35	21	
車載用HDD等	60	68	68	75	75	82	
ITソリューション	114	123	106	148	103	99	
計装品その他	85	99	94	130	83	93	
先端産業部材	661	730	732	771	802	777	
工業材料	278	287	326	325	336	339	
光関連部材	70	93	105	102	99	81	
電子デバイス・材料	209	205	203	181	238	219	
機能化学品その他	104	145	98	162	129	138	

(注)科学・医用システムの2009年度4Q売上高のうち、汎用分析機器66億円および解析装置124億円は、項目間で修正を行い、2010年7月公表より5億円増減しております。

<資料取り扱い上の注意>

- ① 本プレゼンテーションで述べられている決算概要及び業績予想は、注記がある場合を除き、すべて連結であり、億円未満を四捨五入しています。
- ② YY/M(e)はYY年M月期予想を表しています。
- ③ 本プレゼンテーションで述べられている装置・機器等の市場情報については注記がある場合を除き、すべて世界市場です。
- ④ 本プレゼンテーションで述べられている将来の当社業績に関する予想は、現時点で知りうる情報をもとに策定されたものです。当社の参画する産業界はテクノロジーの変化が速く、競争の激しい産業です。また、世界経済、半導体市況、為替相場など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。したがって、今後、当社の業績が本プレゼンテーションと異なる可能性があることをお含みおきください。但し、大きな変動がある場合は、証券取引所の適時開示規則及び当社の自発的判断等に基づき、その都度公表していく所存です。

また、この資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

END

2011年3月期第2四半期 決算説明会

お問合せ先
社長室 広報・IRグループ 部長代理 加藤 弘之
TEL:03-3504-5138 FAX:03-3504-5943
E-mail:kato-hiroyuki@nst.hitachi-hitec.com

日立ハイテク

最先端を、最前線へ。